# 第五章 金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFET)

- §5.1 MOSFET的结构和工作原理
- §5.2 MOSFET的阈值电压
- §5.3 MOSFET的直流特性
- §5.4 MOSFET的频率特性
- §5.5 MOSFET的开关特性
- §5.6 MOSFET的功率特性
- §5.7 小尺寸MOSFET
- §5.8 MOSFET的最新研究进展

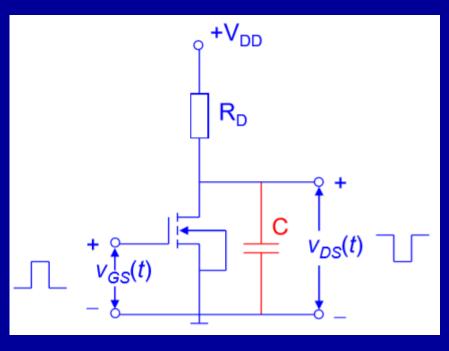
# MOSFET基本知识体系框架



## §5.5 MOSFET的开关特性

- ◆ 和双极性晶体管一样, MOS场效应管也可以用来构成数字集成电路, 例如构成触发器、存储器、移位寄存器等等。
- ◆ 由MOS场效应管构成的集成电路具有功耗小、集成度 高的优点。
- ◆ 在MOS数字集成电路中, MOS场效应管主要工作在两个状态,即导通态和截止态。
- ◆ MOS数字集成电路的特性就由MOS管在这两个状态的特性以及这两个状态相互转换的特性所决定,这就是所谓的晶体管的开关特性。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (1) MOS反相器的开关作用



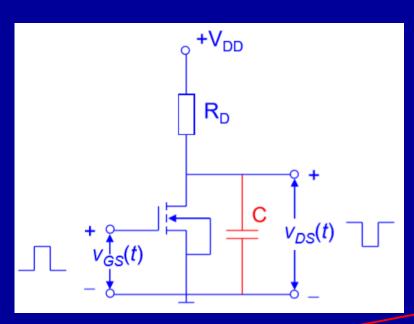
◆如图所示,在增强型NMOS管的漏极加一个负载电阻 $R_D$ ,即可构成一个反相器,以栅源电压 $V_{GS}$ 作为输入端,漏源电压 $V_{DS}$ 作为输出端。

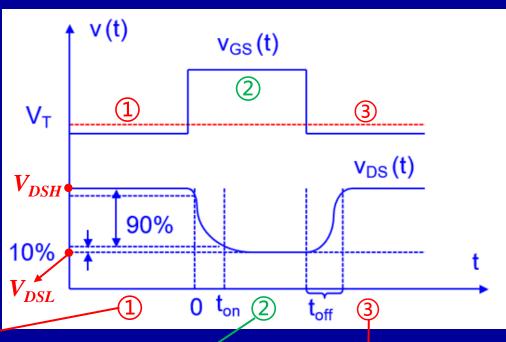
#### ◆电容C的来源:

- ① 漏极结电容
- ② 输出信号线与衬底电容
- ③ 下级MOS管的输入电容

#### 1. 电阻型负载MOS反相器

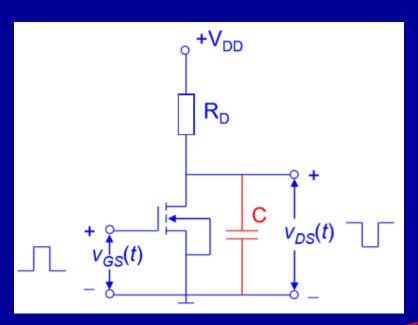
#### (1) MOS反相器的开关作用

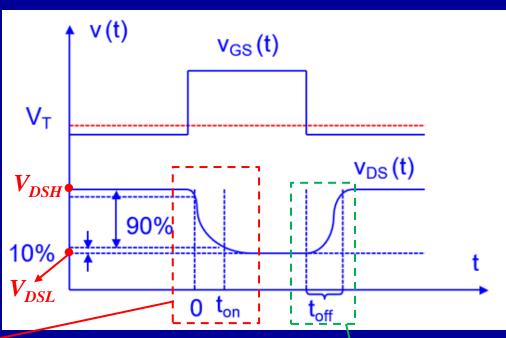




- ① 最开始当输入端 $V_{GS}$ 小于 $V_T$ 时,MOS管不导通,压降绝大部分落在MOS管上,输出电压为高电压  $V_{DSH}$ ( $V_{DSH}$ < $V_{DD}$ )。
- ② 当 $V_{GS}$ 大于 $V_T$ 时, MOS管导通, 压降绝大部分落在 $R_D$ 上,输出低电压 $V_{DSL}$ 。
- ③ 当 $V_{GS}$ 再次小于 $V_T$ 时,MOS管截止,压降绝大部分落在MOS管上,输出高电压 $V_{DSH}$ 。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (1) MOS反相器的开关作用

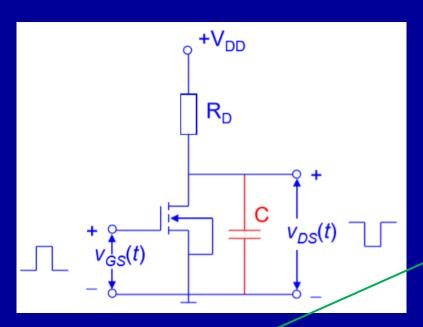




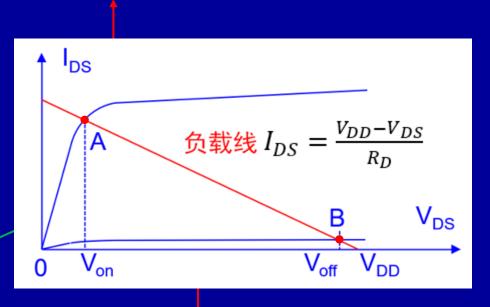
① 当输入端 $V_{GS}$ 由小于 $V_T$ 变为大于 $V_T$ 时,电容的放电不是一瞬间完成的,将输出电压从 $0.9V_{DSH}$ (高电压)下降到 $0.1V_{DSH}$ (低电压)的时间称为导通开启时间 $t_{gg}$ 。

② 当 $V_{GS}$ 再次小于 $V_T$ 时,电容的充电当然也不是一瞬间完成的,将 $V_{DSL}$ (低电压)上升到 $0.9V_{DSH}$ (高电压)的时间称为截止关断时间 $t_{off}$ 。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (1) MOS反相器的开关作用



① MOS管导通时的输出特性

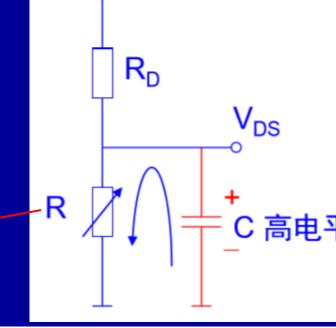


- ③ 对负载 $R_D$ 而言有  $I_{DS} = \frac{V_{DD} V_{DS}}{R_D}$
- ② MOS管截止时的输出特性
- ④ 当负载 $R_D$ 上的电流和MOS管电流相等时就是它们共同的工作状态,A代表MOS管导通(一般在线性区),输出低电压;B代表MOS管截止(一般在饱和区),输出高电压; $V_{off}$ 与 $V_{on}$ 之间的差就是逻辑摆幅。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (2) MOS反相器的开关时间
- $\bigcirc t_{on}$

从工作点B到A,开启时间对应输出电压从高电压 $0.9V_{DSH}$ 下降到低电压 $0.1V_{DSH}$ 的时间,电容对沟道电阻放电。

$$R(t)$$
:  $\infty$  —  $g_{D(On)}^{-1}$  — MOS管开启  
后电阻



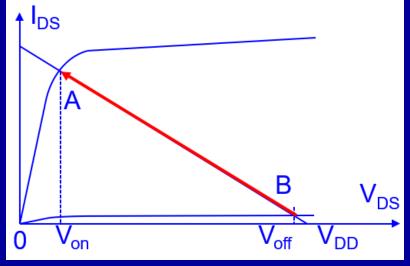
## 估算t<sub>on</sub>

平均电阻:

$$\bar{R}(t) \approx \frac{1}{g_{D(on)}}$$

则: 
$$t_{on} = \bar{R}(t)C = \frac{C}{g_{D(on)}}$$

MOS一般工作在线性区,线性区漏导等于饱和区跨导,故 $t_{on}$ 还可写为  $\frac{c}{g_{ms}}$ 

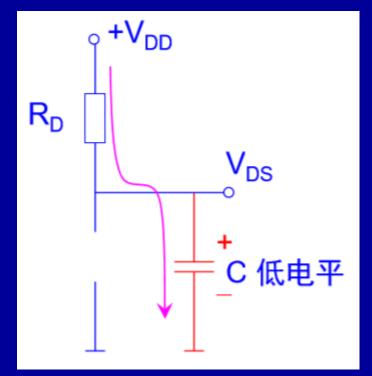


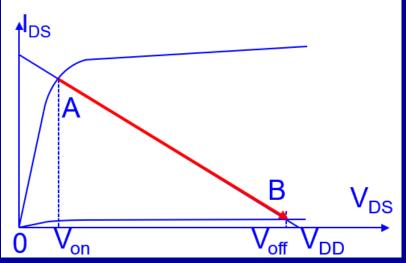
- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (2) MOS反相器的开关时间
- $2t_{off}$

从工作点A到B,开启时间对应输出电压从低电压 $V_{DSL}$ 上升到高电压 $0.9V_{DSH}$ 的时间, $V_{DD}$ 通过 $R_D$ 对电容充电。

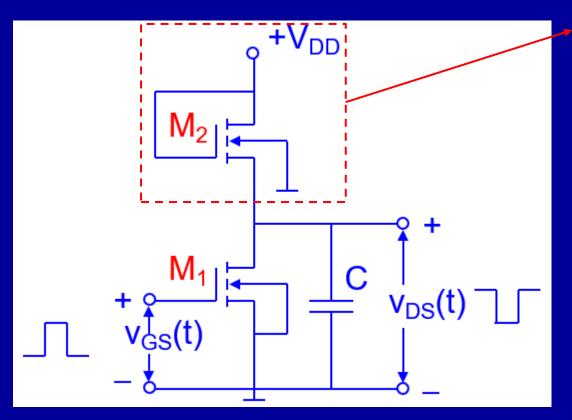
估算 $t_{off}$ 

$$t_{off} = R_D C$$





#### 2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)

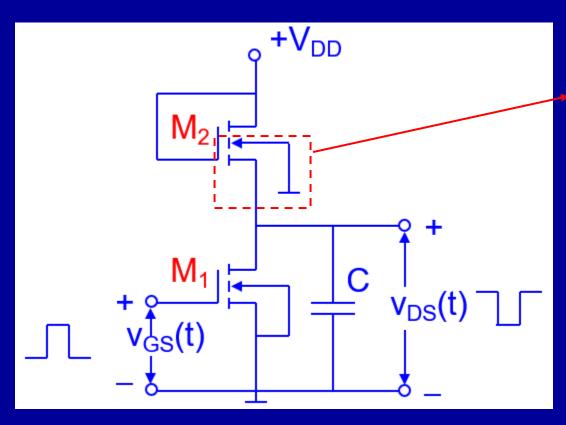


 $V_{DS2}$ :  $M_2$ 的漏源电压  $V_{T2}$ :  $M_2$ 的阈值电压

 $V_{GS2}$ :  $M_2$ 的栅源电压  $V_{DS}(t)$ : 输出电压

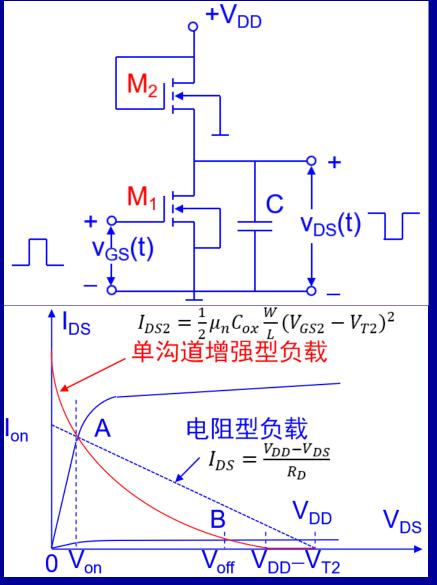
① M。栅漏短接,工作电压 一直为 $V_{DD}$ 。 $I_{DS}$ 的饱和条 件是 $V_{DS}=V_{GS}-V_T$ , 此时对  $M_{2}$ ,  $V_{DS2}=V_{GS2}>V_{GS2}-V_{T2}$ , M。始终处于饱和状态,在  $M_1$ 开启之前, $V_{DD}$ 对C充电, 直到 $V_{DS}(t)=V_{DD}-V_{T2}$ ,并且  $V_{DS}(t)$ 最大只能到 $V_{DD}-V_{T2}$ , 因为如果 $V_{DS}(t) > V_{DD} - V_{T2}$ , M。就截止(关断)了,相当 于"自己把自己截止了"。

2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



② 在此反相器中 $M_2$ 衬底接地,而源上电势 $V_{DS}(t)$ 不为零,会一直增加,所以存在衬偏效应, $V_{T2}$ 会随着 $V_{DS}(t)$ 的增加而一直增加,这样会影响到对电容充电时的电流 $I_{DS}$ (即流经 $M_2$ 的电流)。

#### 2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)

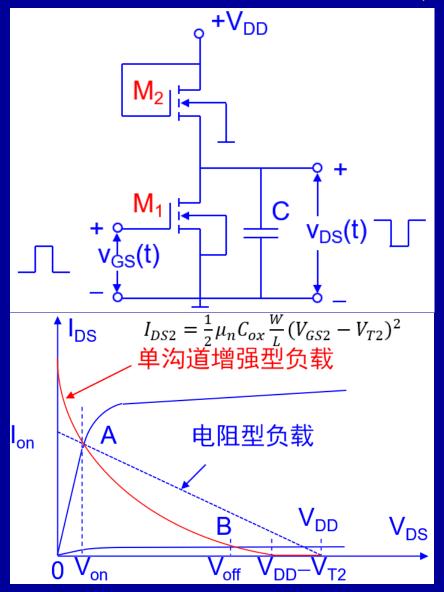


③ M<sub>2</sub>一直工作在<mark>饱和区</mark>,所以有

$$I_{DS2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{T2})^2$$

由于衬偏效应, $V_{T}$ 会一直上升,同 时 $V_{GS2}=V_{DD}-V_{DS}(t)$ ,随着 $V_{DS}(t)$ 的上 升 $V_{GS2}$ 下降,所以 $I_{DS2}$ 会以电压的平 <u>方系数下降</u>,如左下图红线,在对电 容C的充电过程中Inst的下降是非线 性的, 相较于电阻型负载电流要小, 所以E-E MOS反相器的关断过程(电 容充电过程)比电阻型负载MOS反相 器慢,并且从图中可以看出E-E MOS 反相器的逻辑摆幅也会较小(缺点)。

#### 2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



④ <mark>导通过程</mark> (电容放电过程),与电阻型负载反相器一样。

导通时(A工作点), $M_1$ 线性, $M_2$ 饱和,估算导通态电压 $V_{on}$ 和电流 $I_{on}$ :

$$V_{GS2} = V_{DD} - V_{on} \quad V_{on} = V_{DS}(t)$$

$$V_{GS1} = V_{GS}(t) \qquad \beta = \mu C_{ox} \frac{w}{L}$$

#### M<sub>1</sub>线性区

$$I_{on} = \beta_1 [(V_{GS1} - V_{T1})V_{on} - \frac{1}{2}V_{on}^2]$$

$$I_{on} \approx \beta_1 (V_{GS1} - V_{T1}) V_{on}$$

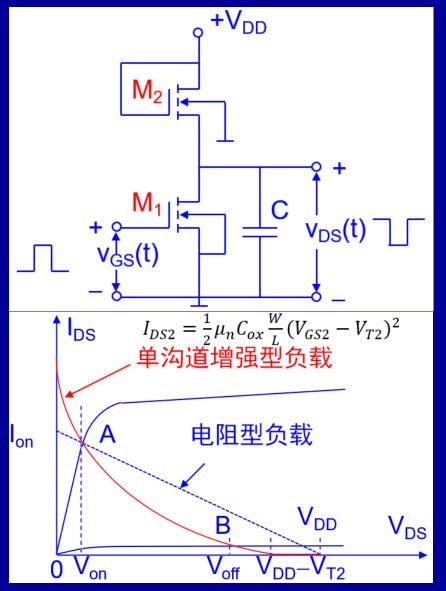
#### M。饱和区

$$I_{on} = \frac{1}{2}\beta_2[(V_{DD} - V_{on}) - V_{T2}]^2$$

$$I_{on} \approx \frac{\beta_2}{2} (V_{DD} - V_{T2})^2$$

$$V_{on} = \frac{\beta_2}{2\beta_1} \frac{(V_{DD} - V_{T2})^2}{(V_{GS1} - V_{T1})^2}$$

#### 2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



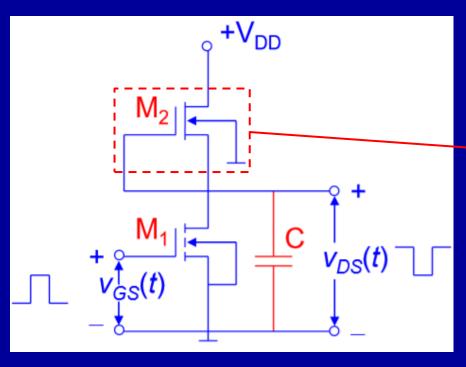
⑤ 关断时(B工作点), M<sub>1</sub>截止, M<sub>2</sub>饱和

$$V_{off} \approx V_{DD} - V_{T2}$$

⑥ E-E MOS的<mark>优点</mark>:面积小,集成度高,都是电子导电;

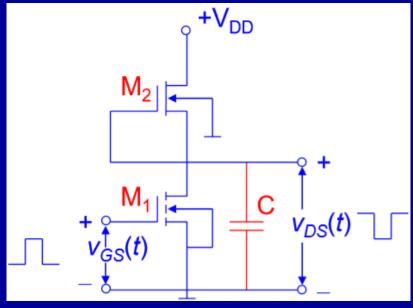
E-E MOS的缺点:  $t_{off}$ 长,导通态功耗大,存在衬偏效应。

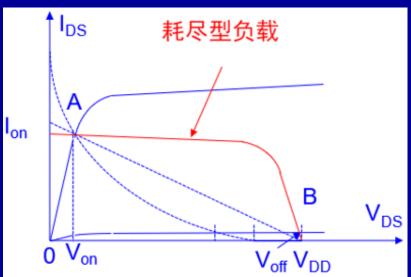
3. 增强型-耗尽型MOS反相器 (E-D MOS)



- ① 导通过程 (电容放电过程) 与前两种反相器一样。
- •②  $M_2$ : 耗尽型NMOS, 阈值电压 $V_{T2}$ <0, 栅源短接,  $V_{GS2}$ =0> $V_{T2}$ ,  $M_2$ 始终处于导通状态, 电流会发生变化,  $V_{DS}$ (t)最大约为 $V_{DD}$ 。

#### 3. 增强型-耗尽型MOS反相器 (E-D MOS)

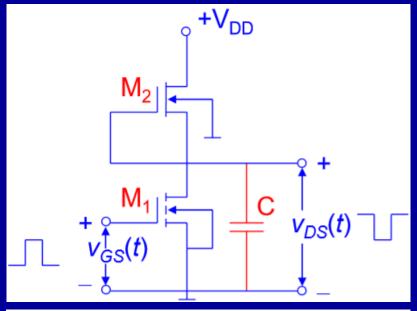


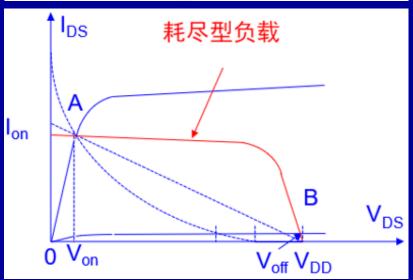


③ 关断过程 (电容充电过程): 初始  $V_{DS}(t)$ 接近于0,  $V_{DS2}=V_{DD}>V_{GS2}-V_{T2}$ , 负载电流 $I_{DS2}$ 处于饱和区; 随着  $V_{DS}(t)$ 上升, $V_{DS2}=V_{DD}-V_{DS}(t)$ 减小,当 $V_{DS}(t)>V_{DD}+V_{T2}$ 时, $V_{DS2}<-V_{T2}$ ,即 $V_{DS2}<V_{GS2}-V_{T2}$ ,负载电流 $I_{DS2}$ 过渡到线性区,如左下图红线所示。

④ E-D MOS反相器在关断过程中电流较大,因此关断时间比电阻型负载 反相器和E-E MOS反相器的短。

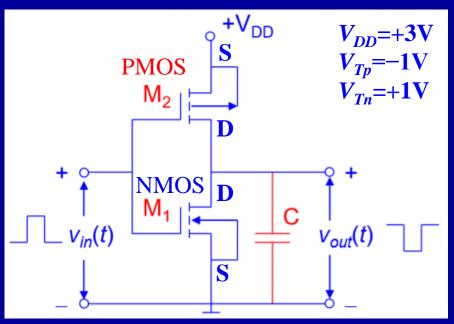
3. 增强型-耗尽型MOS反相器 (E-D MOS)





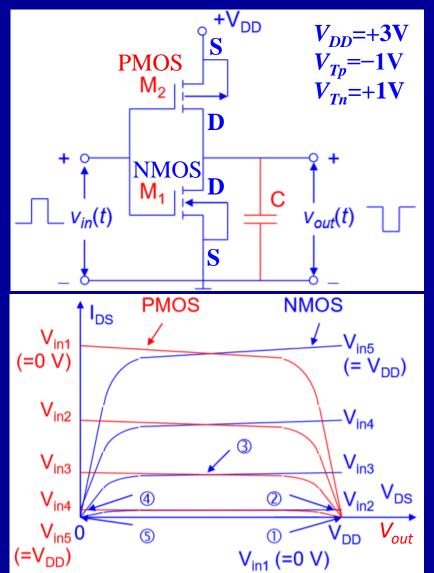
- ⑤ 导通时 (工作点A): M<sub>1</sub>线性, M<sub>2</sub>饱和; 关断时 (工作点B): M<sub>1</sub>截止, M<sub>2</sub>线性。
- ⑥ E-D MOS的优点:  $t_{off}$ 短,集成度高,都是电子沟道导电;
- E-D MOS的缺点:导通态功耗大,存在衬偏效应。

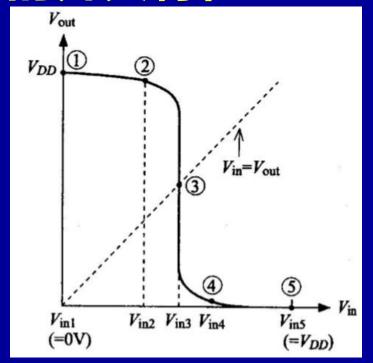
### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)



- ◆ 负载使用增强型PMOS,组成 经典的CMOS反相器。
- ◆ 此时输入是 $V_{in}$ ,输出是 $V_{out}$ ,假设 $V_{DD}$ =3V,NMOS阈值电压 $V_{Tn}$ =1V , PMOS 阈 值 电 压 $V_{Tp}$ =-1V,CMOS完全对称。

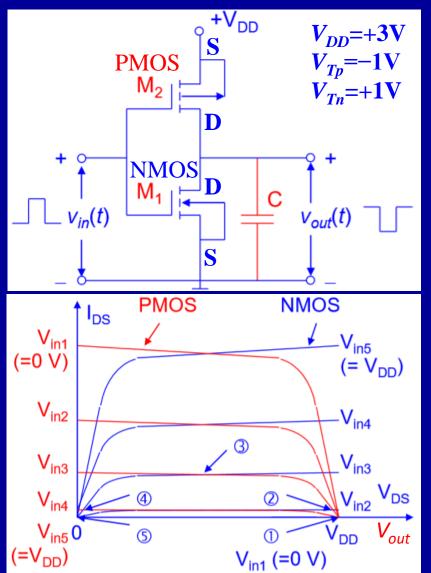
## 4. 互补MOS反相器 (CMOS)

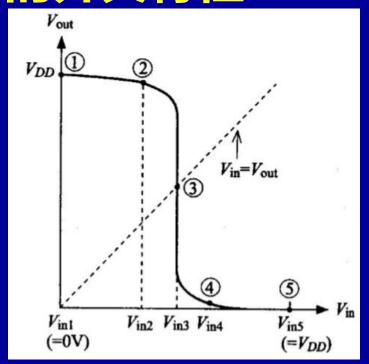




①  $V_{in}$ =0V时,PMOS  $V_{GSp}$ =-3V,处于导通状态;NMOS  $V_{GSn}$ =0V,处于截止状态,输出电压 $V_{out} \approx V_{DD}$ ;而 $|V_{DSp}| < |V_{GSp} - V_{Tp}|$ ,因此PMOS处于线性区,NMOS截止,此时几乎没有静态功耗。

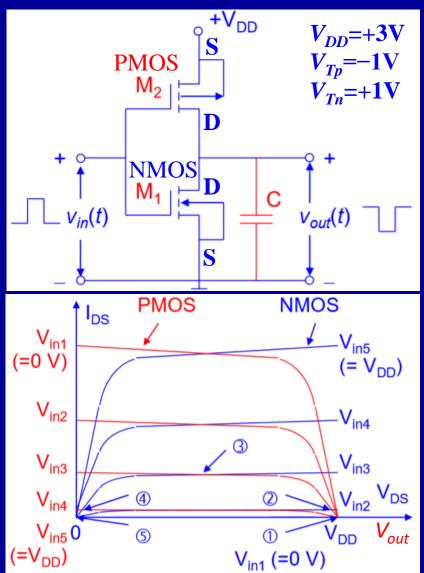
### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)

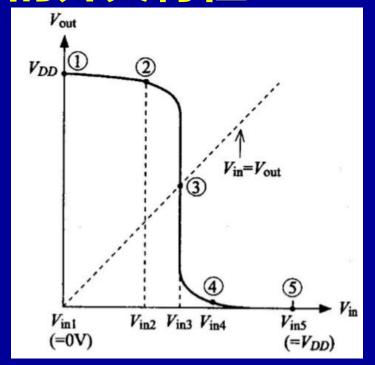




②  $V_{in}$ =1.1V时,PMOS  $V_{GSp}$ =-1.9V,处于导通状态;NMOS  $V_{GSn}$ =1.1V,处于导通状态, $V_{out}$ 略小于 $V_{DD}$ ; $|V_{DSp}| < |V_{GSp} - V_{Tp}|$ ,PMOS处于线性区, $V_{DSn} > V_{GSn} - V_{Tn}$ ,NMOS处于饱和区。

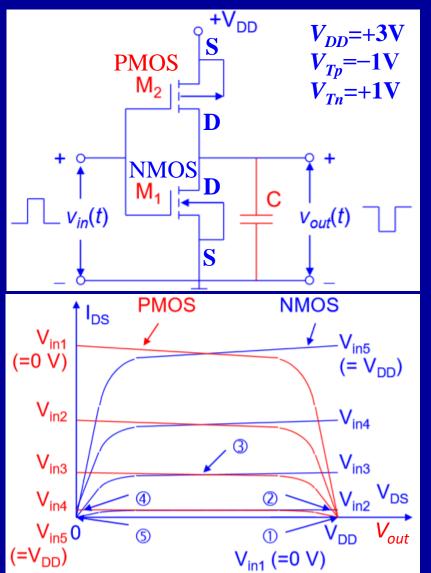
### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)

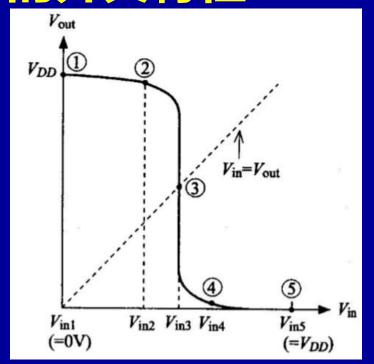




③  $V_{in}$ =1.5V时,PMOS  $V_{GSp}$ =-1.5V,处于导通状态;NMOS  $V_{GSn}$ =1.5V,处于导通状态, $V_{out}$ =0.5 $V_{DD}$ ; $|V_{DSp}|>|V_{GSp}-V_{Tp}|$ ,PMOS处于饱和区, $V_{DSn}>V_{GSn}-V_{Tn}$ ,NMOS处于饱和区。

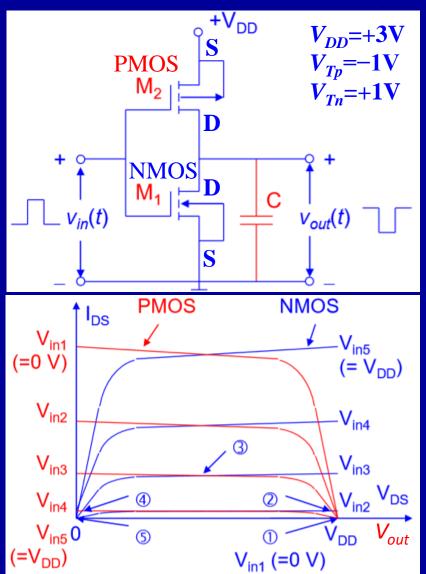
#### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)

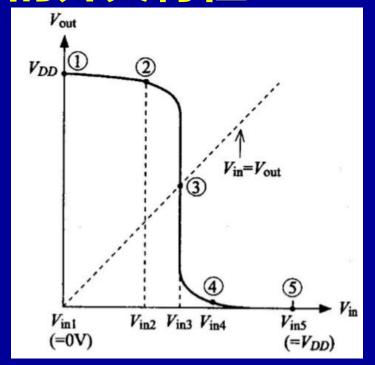




④  $V_{in}$ =1.9V时,PMOS  $V_{GSp}$ =-1.1V,处于导通状态;NMOS  $V_{GSn}$ =1.9V,处于导通状态, $V_{out}$ 略大于0V; $|V_{DSp}|>|V_{GSp}-V_{Tp}|$ ,PMOS处于饱和区, $V_{DSn}< V_{GSn}-V_{Tn}$ ,NMOS处于线性区。

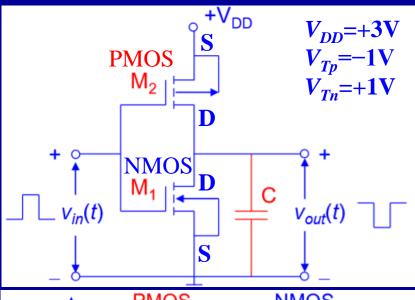
### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)

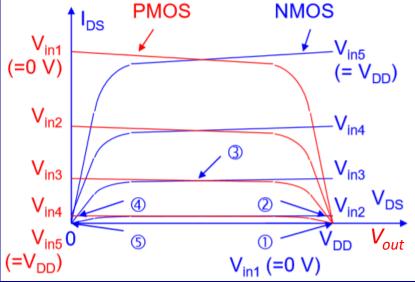


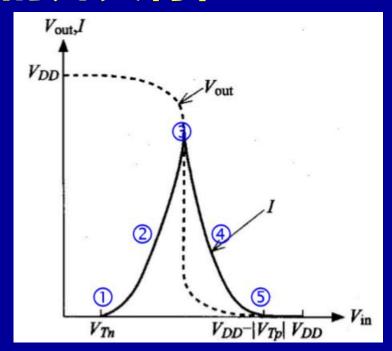


⑤  $V_{in}$ =3V时, PMOS  $V_{GSp}$ =0V, 处于截止状态; NMOS  $V_{GSn}$ =3V, 处于导通状态,  $V_{out}$ ≈0V; PMOS 处于截止状态,而由于 $V_{DSn}$ < $V_{GSn}$ - $V_{Tn}$ , NMOS处于线性区。

#### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)

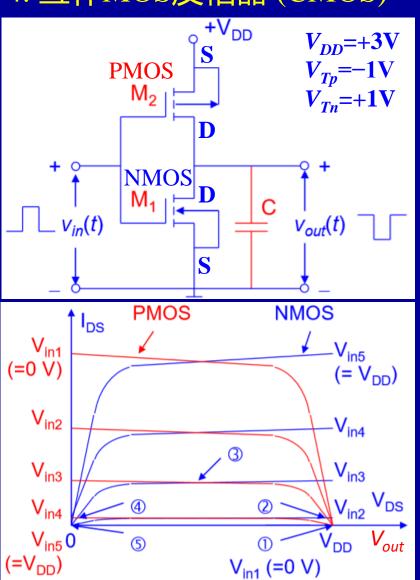






⑥ 虚线代表电压,实线代表电流;虽然CMOS的静态功耗很小,但是在"0"、"1"转换的过程中,当PMOS与NMOS同时导通且处于饱和区时,流经电路的电流达到最大,此时动态功耗很大。

#### 4. 互补MOS反相器 (CMOS)



⑦ CMOS优点: 静态功耗小 (始终有一个管子处于截止状态),可以将 CMOS反相器中的两个管子跨导做得较大,使导通时的等效电阻小些,从 而缩短开关时间,这样在两个状态转换过程中虽然两个管子导通时的电流很大,但是由于电阻较小,开关时间短,所以总的来说总功耗很小。

CMOS<mark>缺点</mark>:由于管子类型不同,单 元面积大。

# 第五章 金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFET)

- §5.1 MOSFET的结构和工作原理
- §5.2 MOSFET的阈值电压
- §5.3 MOSFET的直流特性
- §5.4 MOSFET的频率特性
- §5.5 MOSFET的开关特性
- §5.6 MOSFET的功率特性
- §5.7 小尺寸MOSFET
- §5.8 MOSFET的最新研究进展

# §5.6 MOSFET的功率特性

#### 功率MOSFET的优点:

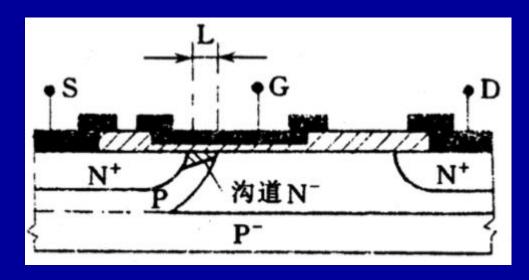
- ① 多子器件,没有少子存储效应,工作频率高,开关速度快。
- ② MOS管是电压控制器件,输入阻抗高,作功率开关使用时, 所需驱动电流小,驱动功率小,驱动电路简单,功率增益 大且稳定性好。
- ③ 器件工作时温度上升,晶格散射上升,沟道载流子迁移率下降,电流下降,温度下降,有一个温度负反馈,热稳定性好。

#### 功率MOSFET的缺点:

① 开启电压 $V_{on}$ 和导通电阻 $R_{on}$ 比双极性晶体管大。

1. LDMOS (横向双扩散)

优点:沟道短,跨导大,频率特性好;高压时,N<sup>-</sup>区耗尽区宽度大,击穿电压大。



缺点:管芯面积大。

漏端双扩散形成一重掺一轻掺两个N型区域,N¯区紧挨P型衬底,在高压情况下,耗尽区不仅在P型衬底一侧有,在N¯区更大,可以有效提高器件击穿电压,同时N¯区的存在也避免了穿通效应。

2. VVMOS (垂直V型槽)

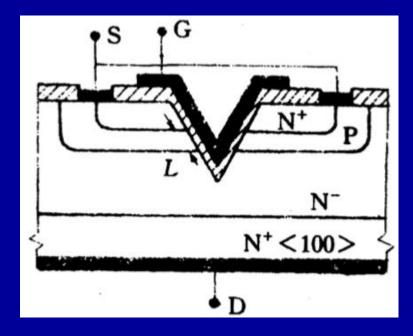
优点:管芯面积小。

缺点: V形槽会导致尖端

电场,使击穿电压下降;

导通电阻大;腐蚀很难控

制,可靠性下降。

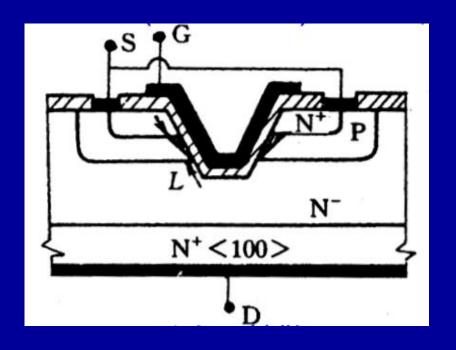


为了减小管芯面积,将器件做成垂直型晶体管,但是V形槽结构在工艺上的控制十分困难,可靠性低,同时V形槽会让电场大部分聚集在其底部,从而使器件较早地击穿,电流在此处会有拥挤效应,所以导通电阻也较大。

#### 3. VUMOS (垂直U型槽)

优点:消除了尖端电场,使 击穿电压上升; N<sup>-</sup>区飘移电 流易展开,导通电阻下降。

缺点: 刻蚀很难控制,可靠性下降。



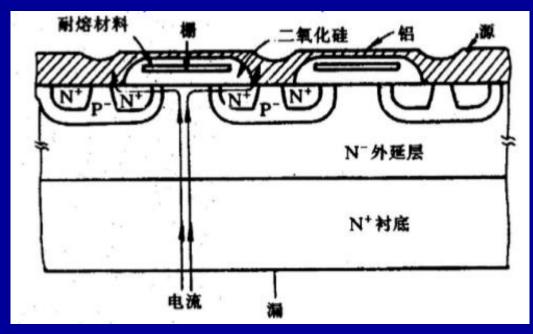
将V形槽改为U形槽,减弱尖端电场和电流拥挤效应。

4. VDMOS (垂直双扩散)

优点: 击穿电压很大,

可靠性高。

缺点:导通电阻大。



电流从底部的漏流经N+区和N¯区,经过沟道进入源,由于有一层很厚的N¯区,所以器件击穿电压高,导通电阻大,没有刻蚀工艺,因此工艺稳定性高。